

# 新しいスパッタ法による酸化物および窒化物薄膜の超高速作成装置

著者	畑 朋延
著者別表示	Hata Tomonobu
雑誌名	昭和57(1982)年度 科学研究費補助金 試験研究 研究課題概要
巻	1981 1982
ページ	2p.
発行年	2016-04-21
URL	<a href="http://doi.org/10.24517/00068511">http://doi.org/10.24517/00068511</a>



# 新しいスパッタ法による酸化物および窒化物薄膜の超高速作成装置

Research Project

All



## Project/Area Number

56850093

## Research Category

Grant-in-Aid for Developmental Scientific Research

## Allocation Type

Single-year Grants

## Research Field

電子材料工学

## Research Institution

Kanazawa University

## Principal Investigator

畑 朋延 金沢大学, 工学部, 助教授

## Project Period (FY)

1981 - 1982

## Project Status

Completed (Fiscal Year 1982)

## Budget Amount \*help

¥5,000,000 (Direct Cost: ¥5,000,000)

Fiscal Year 1982: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)

Fiscal Year 1981: ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)

**URL:** <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-56850093/>

Published: 1987-03-30 Modified: 2016-04-21